




洗浄剤ラインナップ

FRANKLAB **fb** フランクラブ
<http://www.franklab.com>

アルカリ性洗浄剤



TFD 4
 TFD 4は、起泡性を持つアルカリ性洗浄剤です。幅広い用途で使用されています。

用途

- 強力な汚れ
- スラリー洗浄
- フォトマスク洗浄
- ベアガラス洗浄
- フォトレジスト剥離液
- オフラインモードのITO
- 液晶パネルガラス基板
- シリコンウェーハの脱脂
- 精密機械部品洗浄
- オプティカルガラスを使用したプリズムレンズ
- CFやBM樹脂の着色剤のやり直し
- パラフィン、ワックス洗浄

特徴

機械洗浄	×
浸漬超音波	○
pH	13.5
温度	40℃～75℃
使用濃度	1%～5%



TFD 4L
 起泡性の『アルカリ性洗浄剤』。すすぎが簡単で、アルミニウム洗浄に適しています。

TFD 4L

起泡性の『アルカリ性洗浄剤』。すすぎが簡単で、アルミニウム洗浄に適しています。

用途

- Al、Ag 基板の脱脂
- パーティクル除去
- ※表面を傷めません

特徴

機械洗浄	×
浸漬超音波	○
pH	12.6
温度	40℃～75℃
使用濃度	1%～10%



TFD 66
 すすぎが簡単な低泡性の『アルカリ性洗浄剤』。アルミニウムに最適

TFD 66

すすぎが簡単な低泡性の『アルカリ性洗浄剤』。アルミニウムに最適

用途

- Al、Ag 基板の脱脂
- パーティクル除去
- ※表面を傷めません



TFD@ 4
 TFD@ 4は、非常に低い界面活性で、かつすすぎが簡単な低泡性の『アルカリ性洗浄剤』です。

TFD@ 4

TFD@ 4は、非常に低い界面活性で、かつすすぎが簡単な低泡性の『アルカリ性洗浄剤』です。

用途

- 強力、高度に濃縮した汚れ
- ITO ガラス洗浄
- 高度な条件を満たすベアガラス接合部

特徴

機械洗浄	○
浸漬超音波	×
pH	13.4
温度	40℃～75℃
使用濃度	1%～5%



TFD 7
 TFD 7は、低泡性のためすすぎが簡単にできる『アルカリ性洗浄剤』です。シリコンウェーハのラッピングやITO ガラス洗浄に使用。

用途

- 成膜後 / 前工程ガラス洗浄
- ポリッシング過程 / 偏光板貼付前のLCD 最終洗浄

特徴

機械洗浄	○
浸漬超音波	×
pH	13.5
温度	40℃～75℃
使用濃度	1%～10%




TFD 13
 TFD 13は、低泡性を持つ『アルカリ性洗浄剤』です。強力で、濃縮した汚れにも効果的です。

用途

- 紙跡
- カビ
- ITO ガラス洗浄
- 強い油脂を取り除くためのベアガラス

特徴

機械洗浄	○
浸漬超音波	×
pH	14
温度	40℃～75℃
使用濃度	1%～10%



TD-A7
 TD-A7は、すすぎが簡単な低泡性の『中性洗浄剤』です。

用途

- 成膜後 / 前工程のガラス洗浄
- ITO ガラス洗浄
- シリコンウェーハのラッピング、ポリッシング過程
- 偏光板貼付前のLCD 最終洗浄合部

特徴

機械洗浄	○
浸漬超音波	×
pH	13.5
温度	40℃～75℃
使用濃度	1%～10%

有機系洗浄剤シリーズ

用途	TFDO 4	TFDO 7	TFDO N	TFDO W	TFDO W3
TFT 各種薄膜の成膜 ・半導体 ・トランジスタのすき間 ・接合部	TFDO 4は、起泡性を持つ『アルカリ性洗浄剤』です。イオンフリー。	TFDO 7は、低泡性が特徴の『アルカリ性洗浄剤』です。すすぎが簡単で、イオンフリー。	TFDO Nは、起泡性を持つ『中性洗浄剤』です。イオンフリー。	TFDO Wは、低泡性とイオンフリーが特徴の『中性洗浄剤』です。	TFDO W3は、低泡性とイオンフリーが特徴の『中性洗浄剤』です。フォトマスクケースやサファイアウェーハにも
特徴					
機械洗浄	×	○	×	○	○
浸漬超音波	○	×	○	×	×
pH	13.5	13.5	7	6.5	6.5
温度	40℃～60℃	40℃～60℃	40℃～60℃	30℃～50℃	30℃～50℃
使用濃度	1%～5%	1%～5%	1%～5%	1%～5%	1%～5%

酸性洗浄剤



STR-P

『弱酸性洗浄剤』。
各種薄膜、軽金属、
金属製部品の洗浄に。

特徴	
機械洗浄	×
浸漬超音波	○
pH	4.5 (1%)
温度	30℃～90℃
使用濃度	1%～5%



ACIDOX

ACIDOXは、
『酸性洗浄剤』。
装置にこびり付いた
スラリー除去や
メンテナンスに使用。

特徴	
機械洗浄	×
浸漬超音波	○
pH	1
温度	常温
使用濃度	原液



STR 88

STR 88は、低泡性起泡性の
『エポキシ樹脂剥離液』です。
ウェーハ製造工程での
インゴットカッティング後
のエポキシ樹脂を除去。

特徴	
機械洗浄	○
浸漬超音波	○
pH	1.8
温度	30℃～90℃
使用濃度	10%～30%

中性洗浄剤



TFD N

起泡性『中性洗浄剤』です。
強力な汚れを落とし、Al成膜後
のOPC感光ドラムに残った油脂
や指紋除去などに使用されます。

特徴	
機械洗浄	×
浸漬超音波	○
pH	7
温度	40℃～60℃
使用濃度	1%～5%



TFD W

すすぎが簡単な低泡性『中性洗浄剤』
です。ライトな使用感が特徴。
ウェーハ裏面のサンドブラスト工程後
に行われるパーティクル洗浄に使用。

特徴	
機械洗浄	○
浸漬超音波	×
pH	7
温度	50℃～60℃
使用濃度	1%～10%



TA7-P

ポリカーボネート、アクリル各種
材質のレンズ。
各種薄膜の成膜前後に。

特徴	
機械洗浄	×
浸漬超音波	○
pH	7
温度	40℃～75℃
使用濃度	1%～3%



TFD LC-S

溶剤を含まず、
人体に優しい水溶性
『中性洗浄剤』です。

LCD製造工程での液晶注入、封止後に残留した
液晶を分解・除去。

※液晶洗浄、非有害性、非汚染
※表面を傷めません

特徴	
機械洗浄	×
浸漬超音波	○
pH	9.8
温度	60℃～80℃
使用濃度	1%～25%



1976年にフランスで設立した**FRANKLAB**社は、ガラス器具や医療機器の洗浄と放射能汚染除去を目的とした《産業用洗浄剤》のメーカーとしてスタートしました。

現在では、食品製造業から半導体製造などのハイテク産業に至るまでさまざまな分野で採用実績を残しています。

フランクラブ洗浄剤は、溶剤を含まず環境に優しい「水系洗浄剤」シリーズです。

中和剤ラインナップ

--- 用途 ---

- ・中和剤
- ・低泡性のシリーズ

NEUTRAX RF

アルカリ性製品で洗浄後に
ガラス表面を中和、基板の
すすぎの効率化。
残った界面活性剤除去し、
基板の電荷を修復します。

PHOSPHAX

アルカリ性製品で洗浄後に
ガラス表面を中和、基板の
すすぎの効率化。
残った界面活性剤除去し、
基板の電荷を修復します。

特徴		
機械洗浄	○	○
浸漬超音波	○	○
pH	3.8 (1%)	2.1 (1%)
温度	30℃～90℃	30℃～90℃
使用濃度	1%～3%	1%～5%



株式会社トリコ

〒105-0004 東京都港区新橋3-6-6

TEL:03-3503-1711 FAX:03-3503-1755

www.torico-ltd.co.jp : www.toricomall.com